PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-192273

(43)Date of publication of application: 28.07.1995

(51)Int.CI.

G11B 7/007

G11B 7/24 G11B 7/26

(21)Application number: 05-348694

(71)Applicant: VICTOR CO OF JAPAN LTD

(22) Date of filing:

27.12.1993

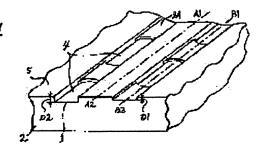
(72)Inventor: KASAI TOSHIKI

(54) OPTICAL RECORDING MEDIUM AND ITS PRODUCTION

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain an optical disk having a structure capable of stably reproducing information recorded at a high density on the optical disk.

CONSTITUTION: On this optical disk 1, continuous grooves 3 are formed in a track direction and further, pits 4 meeting information signals are formed in these continuous grooves 3. These pits 4 are formed at depths different from the depths of the continuous grooves 3 in the continuous grooves 3. The continuous grooves 3 are used to apply good tracking to the system which reproduces only the bright regions in a dark background.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

17.03.2000

[Date of sending the examiner's decision of

16.11.2001

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-192273

(43)公開日 平成7年(1995)7月28日

(51) Int. Cl. 6

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

G11B 7/007

9464-5D

7/24

7215-5D

, 7/26

7215-5D

審査請求 未請求 請求項の数2 FD (全6頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平5-348694

平成5年(1993)12月27日

561

(71)出願人 000004329

日本ビクター株式会社

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番

110

(72)発明者 河西 利記

FΙ

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番

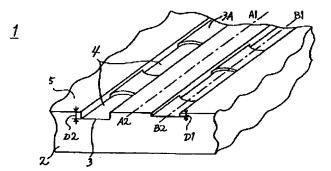
地 日本ビクター株式会社内

(54) 【発明の名称】光記録媒体及びその製造方法

(57)【要約】

【目的】 光ディスク上に高密度に記録された情報を安定して再生することが可能な構造を有する光ディスクを提供する。

【構成】 光ディスク1は、トラック方向に連続溝3が形成され、更にこの連続溝3中には、情報信号に応じたピット4が形成される。ピット4は、連続溝3中に連続溝3とは異なる深さで設けられており、連続溝3は暗い背景中の明るい領域のみを再生している本システムにおいて、トラッキングを良好に掛けるために使用する。



10

【特許請求の範囲】

【請求項1】信号に応じた微小な凹凸によるピットが形 成された光透過性基板上に、特定波長の光または光の熱 を吸収して光透過率が可逆的に変化するマスク層を有 し、このマスク層を用いて前記ピット上に装置側から照 射されるレーザビームの実効スポット径を小さくさせる 光記録媒体において、

1

前記ピットが、このピットの深さと異なる深さでピット の列方向に連続的に設けられた連続溝中に形成してある ことを特徴とする光記録媒体。

【請求項2】信号に応じた微小な凹凸によるピットが、 このピットの深さと異なる深さでピットの列方向に連続 的に設けられた連続溝中に形成された光透過性基板を有 する光記録媒体の製造方法であって、

研磨したガラス原盤上に、前記ピットの深さと等しい膜 厚のフォトレジスト膜を形成する工程と、

前記フォトレジスト膜の膜厚方向の途中まで露光される ような光強度の弱い前記連続溝形成用の第一のレーザ光 と、この第一のレーザ光より光強度が強い前記ピット形 成用の第二のレーザ光とを用いて前記連続溝と前記ピッ 20 トとを形成するための露光パターンを前記フォトレジス ト膜上に形成する工程とを少なくとも有することを特徴 とする光記録媒体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、情報が高密度に記録さ れた光記録媒体及びその再生方法に関わり、特に照射光 強度や温度変化などによって光透過率が変化する光透過 率可変媒体からなるマスク層により照射スポットの実効 スポット径を小さくして光記録媒体上の情報を再生する 30 光記録媒体に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年光ディスクの大容量化が検討され、 種々の提案がなされている。光ディスクは、記録時のレ ーザ光強度を制御することによって光スポット径よりも 小さな記録マークを形成することが可能であるため、記 録時の密度向上には原理上限界はない。しかし、レーザ 光をレンズで絞ったときの光スポット径は、ある一定値 以下には絞れない限界値をもっており、光ディスクの高 かにかかっている。再生限界の記録マークの繰り返し波 長(記録波長)は、1/2NA で与えられる。ここで はλは光の波長、NAはレンズの開口数である。より短 い記録波長の記録マークを識別して再生するためには、 波長んの短い光で再生するか開口数NAの大きなレンズ を用いれば良いことがわかる。しかしながら再生に用い る半導体レーザの短波長化は技術的にも困難が多く、ま た開口数NAの大きなレンズを光ディスク装置に組み込 むことも容易ではない。

【0003】そこで、図7に示すように温度変化或いは 50 安定性の高い方法として知られるが、光ディスク上に照

照射される光の光強度に応じて光透過率特性が可逆的に 変化する光透過率可変物質を光ディスク内に層状に設け ることで、光ディスク上に高密度記録された情報を再生 する方法が従来より知られている。光ディスクの記録及 び再生用のレーザ光の光強度は、通常、ガウス分布を示 し、このようなレーザ光が上記光透過率可変物質層上に 照射されると、光透過率可変物質層が、レーザ光のスポ ット内の温度又は光強度の高い中央部分のみ光透過性と なって、スポット内の他の部分をマスクするマスク効果 (以下、このようなマスク効果を起こす物質層をマスク 層と記載する)を起こすため、照射レーザ光の実際のス ポット径よりも小さな識別マークを検出することができ るのである。上記マスク層に使用される材料としては、 例えば特願平3-201075号公報や、特願平4-7 8458号公報等に開示されているようなフタロシアニ ン、ナフタロシアニン等の光依存性の色素材料や、スピ ロピラン、ラクトン、フルオラン系色素などの温度依存 性の色素材料が使用される。

【0004】また、上記マスク層を有する光ディスク を、再生信号のS/Nをあまり劣化させずに照射レーザ 光のスポット径を小さくして再生する技術が特開平5-12673号公報により開示されている。この開示技術 によれば、光透過率の低い部分の反射率が、光透過率の 高い部分の反射率に較べて十分に低いことを利用して光 ヘッド内のディスクからの反射光をモニターする光検知 器の光量が常に一定になるように出射レーザパワーを制 御している。この結果、光スポット全面積における光透 過率の高い部分の面積比を常に一定になるように制御す ることができるので、安定した再生信号を得ることが可 能になるのである。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上述の従来技 術に基づいて情報を高密度記録した光ディスクを作成し て再生実験を繰り返すうち、再生信号のトラッキングが とりにくく成ることが明らかになった。これは、情報の 高密度記録に伴うピット形状の微小化と、照射レーザ光 を吸収してしまうマスク層に原因があると考えられる。 【0006】ところで、従来よりあるトラッキングエラ 一の検出方法としては、プッシュプル法や3スポット法 密度化はいかに再生レーザ光のスポット径を小さくする 40 が代表的である。プッシュプル法は、光ディスクからの 反射光を2分割し、それぞれの強度を比較する方法であ る。このプッシュプル法は、フォーカシング誤差検出用 の四分割光検出器を共用でき、余分な光学部品がいらな い等、構成の単純さでは有効な方法である。また、3ス ポット法は、信号及びフォーカシング誤差信号を検出す るためのメインレーザスポットの前後に照射するトラッ キング誤差信号検出用のサブレーザスポットを照射し、 このサブレーザスポットを用いてトラッキングサーボを 掛けるものである。この3スポット法は、動作が確実で

4

射される3つのレーザスポットは、1つの半導体レーザ より出力されるレーザ光を、回析格子等を用いて分けて 生成するため、光を吸収して光透過率が変化するマスク 層を有する光ディスクの再生装置に採用するには光強度 の確保等の問題もあり、上述のプッシュプル法の方が有 利である。

【0007】このように、マスク層を有する光ディスク においては、プッシュプル法によるトラッキング検出の 方が有利である。しかし、このプッシュプル法は、ピッ トの形状や深さによる影響を受けやすく、高密度に形成 10 された微小なピット上にマスク層が設けられる上述のよ うな光ディスクにおいては、ピットの大きさや形状によ ってマスク層の覆われ方に差が生じ、位相差検出のため の反射光の差が小さくなってトラッキング検出が困難に なる。また、光ディスク上に情報が高密度に記録されて いれば、ディスクの偏心や反りによるトラッキングズレ もトラックピッチやピット形状に比べて非常に大きくな り、更に、ディスクの面振れによるフォーカスズレの発 生で実効スポット径が変化してもトラッキングズレが発 生するので、再生信号が不安定になってしまう。また、 再生信号が不安定になってしまうだけでなく、トラック ジャンプやサーチ等の機能面においても不都合が生じて しまう。このように情報が高密度記録された光ディスク においては、再生の際にトラッキングズレが発生しやす くて安定な再生信号を得ることは難しく、現行のCDの 記録密度では問題とならなかったことでも大きな問題と なる。

【0008】そこで本発明は上記の点に着目してなされたものであり、光ディスク上に高密度に記録された情報を安定して再生することが可能な構造を有する光ディス 30 クを提供することを目的とするものである。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記目的を達成するための手段として、信号に応じた微小な凹凸によるピットが形成された光透過性基板上に、特定波長の光または光の熱を吸収して光透過率が可逆的に変化するマスク層を有し、このマスク層を用いて前記ピット上に装置側から照射されるレーザビームの実効スポット径を小さくさせる光記録媒体において、前記ピットが、このピットの深さと異なる深さでピットの列方向に連続的に設40けられた連続溝中に形成してあることを特徴とする光記録媒体を提供しようとするものである。

【0010】また、本発明は、上記目的を達成するための手段として、信号に応じた微小な凹凸によるピットが、このピットの深さと異なる深さでピットの列方向に連続的に設けられた連続溝中に形成された光透過性基板を有する光記録媒体の製造方法であって、研磨したガラス原盤上に、前記ピットの深さと等しい膜厚のフォトレジスト膜を形成する工程と、前記フォトレジスト膜の膜厚方向の途中まで露光されるような光強度の弱い前記連50

続溝形成用の第一のレーザ光と、この第一のレーザ光より光強度が強い前記ピット形成用の第二のレーザ光とを用いて前記連続溝と前記ピットとを形成するための露光パターンを前記フォトレジスト膜上に形成する工程とを少なくとも有することを特徴とする光記録媒体の製造方法を提供しようとするものである。

[0011]

【実施例】上述のように、情報を高密度記録することに よってトラッキングズレが発生しやすくなることから、 光ディスクの構造をトラッキングサーボのためのトラッ キングエラー信号を良好に検出することが可能なものと した。特に、マスク層を有する光ディスクの再生装置の トラッキングエラー検出においては、プッシュプル法が 最も有利なことから、このプッシュプル法を用いてトラ ッキングエラー検出を行うのに最も適した構造とした。 【0012】以下、添付図面を参照して本発明の実施例 について説明する。図1は本発明の実施例の光ディスク に用いられる光透過性基板(以下、単に基板と記載す る) 2の一部拡大図であり、トラック方向に連続溝3が 形成され、更にこの連続溝3中には、情報信号に応じた ピット4が形成される。また、上記基板2上には、図2 に示すように、上記マスク層10、反射膜11、及び保 護膜12が順次積層される。ここで、図2(A)は、図 1に示すA1-A2を通る線の断面図であり、上記連続 溝3,3間のランド部5における光ディスク1の断面図 を示す。また、同図(B)は、図1に示すB1-B2を 通る線の断面図であり、連続溝3内の断面図を示すもの である。ピット4は、連続溝3中に連続溝3の溝深さD 1とは異なる深さD2で設けられており(図1参照)、 連続溝3は暗い背景中の明るい領域のみを再生している 本システムにおいて、トラッキングを良好に掛けること のできる役目をするものである。ピット4のみの場合 と、連続溝3の場合とではプッシュプル法によるトラッ キングサーボの掛けやすさは断然連続溝3の方が有利で あることは当事者周知のことである。

【0013】これら連続溝3の溝深さD1及びピット4が形成されている部分の溝深さD2(図1参照)は、基板2の屈折率、使用するレーザ光の波長、及びマスク層の屈折率とその厚さなどの条件から、任意に最適に設定可能である。例えば、図3に示すような溝深さと反射光量及びトラッキングエラー信号出力(例えば2D-PDを用いたプッシュプル法による差分信号出力)の関係から、連続溝3の溝深さD1をD1<2/>
レ、ピット4の溝深さD2をD2<2/>
レ、ピット4の溝深さD2をD2<2/>
とで、図2に示すように、マスク層10は、ピット4、連続溝3内のランド部3A、及びランド部5それぞれで膜厚が異なり、特にピット4の大きさによってもその膜厚は異なるため、上記連続溝3の溝深さD1及びピット4が形成されている部分の溝深さD2は、このようなマ

スク層10の膜厚の不均一さを考慮して設定することが、 望ましい。

【0014】また、連続溝3及びピット4は、トラック 方向及びディスクの半径方向に対して高密度に記録され ており、ピット4は基準周波数に対してある範囲内で時 間的に整数倍の信号の組み合わとなるような信号で構成 されている。即ち、一般に情報信号は従来よりあるCD (コンパクトディスク) の記録方式で知られているよう に基準周波数に対してある範囲内で時間的に整数倍の信 号の組み合わせで成り立っている。CDの場合はピット 10 長が3 Tから11 Tの範囲での情報信号の組み合わせで 成り立っており、3 Tが最も短い(小さい)ピット長で あり、11Tが最も長い(大きい)ピット長である。高 密度記録媒体システムにおいてもこのように小さいピッ トから大きなピットの組み合わせで情報信号を組み立て ることが、CD方式との整合性を取るためにも有利であ るためである。

【0015】また、上記基板2は、既によく知られてい るように、種々のものを用いることができ、ガラス、エ ポキシ樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリメタクリル酸 20 エステル樹脂、非晶質ポリオレフィン樹脂等、良好な透 明性を有する材料であれば良く、また後述の製造方法に より作成したスタンパを用いて作成される。また、基板 2上には光透過率可変媒体であるマスク層10が積層さ れるがこのマスク層10は、上述した従来と同様な光依 存性や温度依存性の色素材料が使用され、例えばスピン コート法により形成される。また、マスク層10を構成 する色素材料が、真空蒸着法を用いても性質の劣化のな いものであれば、真空蒸着法を用いて形成することも可 能である。このように真空蒸着法を用いてマスク層10 30 を形成すれば、基板 2 上の凹凸に対してほぼ均一な薄膜 を形成できるため、上記連続溝3の溝深さD1及びピッ ト4が形成されている部分の溝深さD2の設定が容易に なる。また、マスク層10の材料として上げた上述の物 質は室温で特定の波長領域に吸収があり、温度上昇や、 照射強度にともなって吸収波長が異なるので再生に使用 するレーザ光波長に応じて適当な物質を選択すれば良 V10

【0016】マスク層10上に設けられている反射膜1 1は、アルミニウム、金等の反射率の高い金属を真空蒸 40 着やスパッタリングなどの手段によって形成する。そし て、この反射膜11上に設けられた保護膜12は、UV 硬化樹脂等をスピンコート法を用いて形成する。以上の ように構成した光ディスク1を、プッシュプル法を用い てトラッキングエラー信号検出を行えば、安定したトラ ッキングサーボを掛けることが可能になるだけでなく、 トラックジャンプやサーチ等のトラックを飛び越して光 スポットの走査を行う際にも安定した動作が行えるよう になる。

て説明する。図4は、本発明の光ディスクの製造方法を 説明するための図である。まずガラス原盤を研磨・洗浄 し、フォトレジスト塗布面全面を平坦化する(10 1)。次に、この平坦化されたガラス面に記録膜となる フォトレジストを、例えばスピンコート法により所定の 厚さ塗布し、このレジスト膜が、ガラス原盤に固着され るよう熱処理を施し記録膜付きのガラス原盤を得る。こ のフォトレジストの膜厚は、上記ピット4の溝深さD2 とする(102, 103)。

【0018】次に、上記記録膜へ情報信号に応じた記録 用レーザ光(例えば、ガスレーザから放射されたレーザ 光を、光変調器を用いて変調をかけ、レンズで集光した ものを使用)を照射して露光する(103)。ここで、 フォトレジストは、照射されるレーザ光の光強度に依存 して露光されるので、記録の際の記録用レーザ光は、図 5に示すようなビームプロファイルの異なる2本のビー ムを用いるようにする。即ち、溝深さの浅い連続溝3を 形成させるための露光は、フォトレジストの膜厚方向の 途中までで良いので、同図に示すように光の最高強度が 低いビームプロファイル21のレーザ光を使用する。そ して、ピット4の形成の露光は、フォトレジストの膜厚 方向に貫通させて行えば良いので、光強度が高いビーム プロファイル22のレーザ光を使用する。また、それぞ れのレーザ光で連続溝3及びピット4形成用の露光がな された時、それぞれの幅R1, R2が等しくなるよう に、それぞれのレーザ光のビームプロファイルが設定さ れる。これらビームプロファイルは、パワーと幅などを 変更すれば任意の形状に変えることが可能であるので、 連続溝3の溝深さD1や、連続溝3及びピット4の幅に 応じて適宜設定するようにする。更に、上記2本の記録 用レーザ光は、同時記録で同一スポット箇所でも良い し、同一トラック上で前後になるように照射しても良 い。また別々のトラックを照射するようにしても良い が、何れの場合も、連続溝3中にピット4列が入るよう に照射位置を制御する。

【0019】次に、現像処理を施し、上記情報信号に応 じた凹凸を形成し(105)、この凹凸の形成された表 面に導電化皮膜の形成後、メッキによってスタンパを作 製し(106)、このスタンパを基に射出成形や、2P 法と呼ばれる紫外線硬化樹脂による型押し方法等の方法 を用いて上記基板2を作成する(107)。このように 得られた基板2上に、上述したようにマスク層10を積 層して(108)、反射膜11を蒸着させ(109)、 更にその上に保護膜12を形成する(110)ことで、 上記光ディスク1を得ることができる。

【0020】なお、上記連続溝3は、トラッキングに関 する情報以外にも例えばトラックをある周波数でウォブ ルさせることで、媒体上での絶対再生時間を検知するこ とも可能である。そのためには、連続溝3の記録時にレ 【0017】次に、上記光ディスク1の製造方法につい 50 ーザビームを変調しながら一定周波数で電圧をビームに

7

直行方向に掛けてやれば良い。このことによってサーチ*機能などの安定を図ることができる。また、連続溝3は、光ディスク1上に、同心円状或いは螺旋状に設けられるもののほか、光ディスク1上の所定位置に設けても良い。この所定位置は装置側との間で予め決められた場所であり、例えば、セクタやデータの先頭を示すヘッダ内(例えば、同期信号毎)に配置する。また、データ構造に関係なく、一定周期に配置しても良い。更に、図6に示すように、光ディスク上の所定位置(例えば、同図中に示す点線位置)に配置しても良く、また、それらを10組み合わせた配置としても良い。このように連続溝3を光ディスク上で一定期間連続的にする場合、連続溝3の形成された部分でトラッキングサーボをかけてその状態を固定し、次の連続溝3が形成された部分で再びトラッキングサーボを掛けるといった再生を行うようにする。

[0021]

【発明の効果】以上説明したように本発明の光記録媒体によれば、信号に応じた微小な凹凸によるピットが形成された光透過性基板上に、特定波長の光または光の熱を吸収して光透過率が可逆的に変化するマスク層を有し、このマスク層を用いて前記ピット上に装置側から照射されるレーザビームの実効スポット径を小さくさせる光記録媒体において、前記ピットが、このピットの深さと異なる深さでピットの列方向に連続的に設けられた連続溝中に形成したので、安定したトラッキングサーボを掛けることができ、高密度記録された信号を安定して再生することが可能になる。

【0022】また、研磨したガラス原盤上に、前記ピットの深さと等しい膜厚のフォトレジスト膜を形成する工程と、前記フォトレジスト膜の膜厚方向の途中まで露光30されるような光強度の弱い前記連続溝形成用の第一のレーザ光と、この第一のレーザ光より光強度が強い前記ピット形成用の第二のレーザ光とを用いて前記連続溝と前

記ピットとを形成するための露光パターンを前記フォトレジスト膜上に形成する工程とを少なくとも有するので、ピットの深さと異なる深さで前記ピットの列方向に連続的に設けられた連続溝中にピットが形成されているような光透過性基板を有する光記録媒体を従来からある装置を用いて製造することが可能であるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

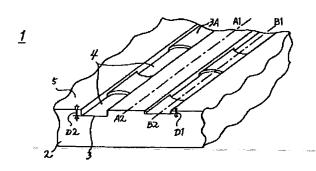
【図1】本発明の一実施例である光ディスクの一部拡大 図である。

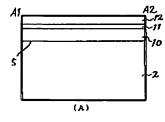
- 【図2】図1における光ディスクの断面図である。
- 【図3】光ディスクにおける溝深さと反射光量及びトラッキングエラー信号の関係を示す図である。
- 【図4】図1における光ディスクの製造方法を説明するための図である。
- 【図5】図4における光ディスクの製造時に使用される ビームプロファイルを示す図である。
- 【図 6】 本発明の他の実施例を示す光ディスクの構成図である
- 20 【図7】本実施例及び従来の光ディスクで使用される光 透過率可変媒体の光透過率特性を示す図である。

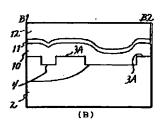
【符号の説明】

- 1 光ディスク
- 2 光透過性基板 (基板)
- 3 連続溝
- 4 ピット
- 5 ランド部
- 1.0 マスク層
- 11 反射膜
- 0 12 保護膜
 - 21 連続溝形成用レーザ光 (第一のレーザ光)
 - 22 ピット形成用レーザ光 (第二のレーザ光)

【図1】







【図2】

